# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-161333

(43)Date of publication of application : 20.06.1997

(51)Int.CI.

G11B 7/26

(21)Application number: 07-346025

(71)Applicant : SONY DISC TECHNOL:KK

(22)Date of filing:

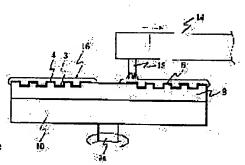
11.12.1995

(72)Inventor: YOSHIMURA YOSHINORI

# (54) DEVICE FOR FORMING LIGHT TRANSPARENT LAYER OF OPTICAL DISK AND **METHOD THEREFOR**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to rapidly form a light transparent layer covering the signal surface of an optical disk with good accuracy. SOLUTION: While a substrate 2 is kept rotated, a liquid UV curing resin 16 is dropped near the center of the signal surface 4 thereof and is supplied to an annular form. The substrate 2 is rotated to diffuse the UV curing resin 16 over the entire part from the central side toward the outer peripheral side by the centrifugal force generated by the rotation. The UV curing resin 16 diffused over the entire part from the central side toward the outer peripheral side is irradiated with UV spot light from the central side to the outer peripheral side of the rotating substrate. by which the UV curing resin is successively cured to a prescribed thickness from the central side to the outer peripheral side.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

21.03.2001

[Date of sending the examiner's decision

of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3449848

[Date of registration]

11.07.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

### (11)特許出願公開番号

## 特開平9-161333

技術表示箇所

(43)公開日 平成9年(1997)6月20日

(51) Int.Cl.\*

識別記号

庁内整理番号

FΙ

- - -

G11B 7/26

5 0 1 7303-5D

G11B 7/26

501

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 5 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平7-346025

平成7年(1995)12月11日

(71)出願人 594064529

株式会社ソニー・ディスクテクノロジー

神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地

(72) 発明者 吉村 芳紀

神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134 株

式会社ソニー・ディスクテクノロジー内

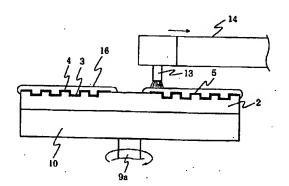
(74)代理人 弁理士 小松 祐治

(54) 【発明の名称】 光ディスクにおける光透過層の形成装置及び方法

### (57)【要約】

【課題】 光ディスクにおいて信号面を覆う光透過層を 精度良く、しかも、短時間に形成することが出来るよう にすることを課題とする。

【解決手段】 基板2を回転させながらその信号面4の中心付近に液状の紫外線硬化樹脂16を滴下して環状に供給し、基板を回転させて、該回転による遠心力によって紫外線硬化樹脂を中心側から外周側まで全体に拡散させ、中心側から外周側まで全体に拡散された紫外線硬化樹脂に紫外線スポット光17を回転している基板の中心側から外周側へ照射して紫外線硬化樹脂を中心側から外周側へ所定の厚さに順次硬化させて行く。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板の信号が形成される面(以下、「信号面」という。)をを覆う光透過層を形成する装置であって、

上記基板を回転させる基板回転手段と、

基板回転手段によって回転されている基板の信号面の中心付近に液状の紫外線硬化樹脂を滴下し環状に供給する 紫外線硬化樹脂供給手段と、

基板の回転による遠心力によって信号面を覆うように分布している紫外線硬化樹脂に紫外線を照射して硬化させ 10 る紫外線供給手段とを備えたことを特徴とする光ディスクにおける光透過層の形成装置。

【請求項2】 紫外線供給手段は紫外線スポット光を照射すると共に該紫外線スポット光を基板の中心側から外周側へ移動させるものであることを特徴とする請求項1 に記載の光ディスクにおける光透過層の形成装置。

【請求項3】 基板の信号面を覆う光透過層を形成する 方法であって、

基板を回転させながらその信号面の中心付近に液状の紫 外線硬化樹脂を滴下して環状に供給する工程と、

信号面の中心付近に環状に紫外線硬化樹脂が供給された基板を回転させて、該回転による遠心力によって紫外線 硬化樹脂を中心側から外周側まで全体に拡散させる工程 と、

中心側から外周側まで全体に拡散された紫外線硬化樹脂 に紫外線を照射して紫外線硬化樹脂を所定の厚さに硬化 させる工程とを有することを特徴とする光ディスクにお ける光透過層の形成方法。

【請求項4】 紫外線硬化樹脂に紫外線を照射する工程が、中心側から外周側まで全体に拡散された紫外線硬化 30 樹脂に紫外線スポット光を回転している基板の中心側から外周側へ移動させながら照射して紫外線硬化樹脂を中心側から外周側へ所定の厚さに順次硬化させて行くものであることを特徴とする請求項3に記載の光ディスクにおける光透過層の形成方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は新規な光ディスクに おける光透過層の形成装置及び方法に関する。詳しく は、光ディスクの信号面を覆う光透過層を短時間で精度 40 良く形成する技術に関する。

### [0002]

【従来の技術】図1に光ディスク1の構造を示す。 【0003】透明な合成樹脂、例えば、ボリカーボネート樹脂によって形成された透明基板2の一方の面にピット(信号を凹凸によって表わしたもの)3が形成され、該ピット3が形成された面(以下、「信号面」と言う。)4がアルミニウム等から成る反射膜5によって覆われている。そして、該反射膜5が透明な保護用の光透過層6によって覆われている。 【0004】そして、光学ビックアップが該光学ビックアップから照射され、反射膜5によって反射されたレーザー光を受光してビット3を読み取るようになっている。

2

[0005]

【発明が解決しようとする課題】従来、光学ピックアップによる信号の読みとりは、レーザー光を基板2側から 照射して行っている(図2参照)。

【0006】ところで、光ディスクの記録密度の高密度化に伴い、基板のそりによる影響を無視できなくなっている。そして、レーザー光が進む媒質のそりによる影響はその媒質の厚みが薄いほど小さくすることが出来るが、通常、基板2の厚みは1.2mm程度有り、これを0.6mm程度まで薄くすることは出来るが、それ以上薄くすることは技術的に困難である。

【0007】そこで、信号面4を覆うように形成される 光透過層6の側からレーザー光を照射することが考えられる(図3参照)が、従来、この光透過層6はその表面 が均一でなく、精度の良い信号の読取及び/又は書込を 20 することが出来ない恐れがある。

【0008】そとで、本発明は、光ディスクにおいて信号面を覆う光透過層を精度良く、しかも、短時間に形成することが出来るようにすることを課題とする。 【0009】

【課題を解決するための手段】上記した課題を解決する ために、本発明光ディスクにおける光透過層の形成装置 は、基板を回転させる基板回転手段と、基板回転手段に よって回転されている基板の信号面の中心付近に液状の 紫外線硬化樹脂を滴下し環状に供給する紫外線硬化樹脂 供給手段と、基板の回転による遠心力によって信号面を 覆うように分布している紫外線硬化樹脂に紫外線を照射 して硬化させる紫外線供給手段とを備えており、また、 本発明光ディスクにおける光透過層の形成方法は、基板 を回転させながらその信号面の中心付近に液状の紫外線 硬化樹脂を滴下して環状に供給する工程と、信号面の中 心付近に環状に紫外線硬化樹脂が供給された基板を回転 させて、該回転による遠心力によって紫外線硬化樹脂を 中心側から外周側まで全体に拡散させる工程と、中心側 から外周側まで全体に拡散された紫外線硬化樹脂に紫外 線を照射して紫外線硬化樹脂を所定の厚さに硬化させる 工程とを有するものである。

【0010】従って、本発明によれば、基板を回転させて、その遠心力によって中心付近に環状に供給された液状紫外線硬化樹脂を信号面全体を覆うように拡散させ、これに紫外線を照射して所定の厚さに硬化させるので、信号面を覆う光透過層を精度良く、即ち、表面の凹凸が無く、かつ、膜厚が均一になるように、しかも短時間で形成することが出来る。

[0011]

50 【発明の実施の形態】以下に、本発明光ディスクにおけ

る光透過層の形成装置及び方法の実施の形態を添付図面 を用いて説明する。尚、以下の説明は、読取専用の光デ ィスク1における光透過層6を形成するものとして説明

する。

【0012】光ディスクにおける光透過層の形成装置7 は機台8にモータ9が支持され、該モータ9の出力軸9 aは上方に向かって延びている。モータ出力軸9 aの上 端には基板載置台10が固定されており、該基板載置台 10の上面に基板2が信号面4を上にした状態で支持さ れるようになっている。これらモータ9、出力軸9 a 及 10 び基板載置台10によって基板回転手段が構成される。

【0013】機台8の上方には基板2の信号面4上に液 状の紫外線硬化樹脂を供給するための紫外線硬化樹脂供 給手段として樹脂供給ノズル11を有する紫外線硬化樹 脂供給機12が設けられている。尚、樹脂供給ノズル1 1は基板載置台10の回転中心から稍外れた位置を指向 するように位置されている。

【0014】また、機台8の上方には基板載置台10上 に支持された基板2の信号面4を覆うように供給された 液状の紫外線硬化樹脂に紫外線スポット光を照射する紫 20 外線供給手段としてUVノズル13を備えたUV照射機 14が配置されている。そして、該UV照射機14はそ のUVノズル13が基板載置台10上に支持された基板 2の中心付近を指向する位置から基板2の外周を外れた 位置を指向する位置までの間を移動することができるよ うにされている。

【0015】以下に、上記光ディスクにおける光透過層 の形成装置7を使用して基板2の信号面4上を覆う光透 過層6を形成する方法について説明する。

【0016】まず、基板載置台10上に基板2を信号面 30 4を上にした状態で載置する(図5参照)。そして、樹 脂供給ノズル11を反射膜5の内周縁と基板中心部との 境界部15を指向するように位置させる。 尚、紫外線硬 化樹脂供給機12が固定的に設けられているものである 場合には、基板2を基板載置台10上に載置した段階 で、樹脂供給ノズル11が上記境界部15を指向すると とになる。

【0017】次いで、モータ9を駆動して基板載置台1 0を、即ち、基板2を低速で回転させながら、紫外線硬 化樹脂16を樹脂供給ノズル11から滴下して、上記境 40 界部15上に紫外線硬化樹脂16を環状に供給する(図 6参照)。

【0018】それから、基板2を高速で回転させて、上 記環状に供給された紫外線硬化樹脂16に遠心力を作用 させて、紫外線硬化樹脂16を中心部から外周部へ信号 面4の全域に行き亘るように拡散させる(図7参照)。 【0019】次いで、UV照射機14を移動させて、U Vノズル13が信号面4全域を覆うように拡散した紫外 線硬化樹脂16の内周端を指向するようにし、基板2を

7を照射して紫外線硬化樹脂16を硬化させる。即ち、 UVノズル13を紫外線硬化樹脂16の内周側から外周 側へと移動させて上記層状となった紫外線硬化樹脂16 を内周側から外周側へと順次硬化させて行く(図8参 照)。このとき、紫外線硬化樹脂16の層が所定の膜厚 になった状態で硬化させるようにする。この為には、次 に硬化させようとする箇所の膜厚が薄いようであれば、 基板2の回転速度を落として作用する遠心力を弱くし、 逆に、膜厚が厚いようであれば、基板2の回転速度を上 げて作用する遠心力を強くする、等の制御を行いながら 膜厚の出たところから硬化させて行くようにすると良 61

【0020】以上のようにして、滴下する紫外線硬化樹 脂16の量、基板2の回転速度、等の諸条件を適宜に選 ぶことにより、信号面4を覆う薄く(0.1~0.2m m) 且つ膜厚が全面に亘って均一な光透過層 6 を効率良 く形成することができる。

【0021】尚、上記実施の形態では、紫外線硬化樹脂 への紫外線の照射として、紫外線スポット光を内周側か **5外周側へ照射して行くものを示したが、これは、スポ** ットタイプのものではない、例えば面照射タイプの紫外 線照射装置を用いて紫外線硬化樹脂の全面に紫外線照射 を行っても良い。

【0022】また、上記例では、読出専用光ディスク1 に光透過層を形成する場合について説明したが、読み書 き可能な光ディスクの光透過層の形成にも適用すること ができることは勿論である。

[0023]

【発明の効果】以上に記載したところから明らかなよう に、本発明光ディスクにおける光透過層の形成装置は、 基板を回転させる基板回転手段と、基板回転手段によっ て回転されている基板の信号面の中心付近に液状の紫外 線硬化樹脂を滴下し環状に供給する紫外線硬化樹脂供給 手段と、基板の回転による遠心力によって信号面を覆う ように分布している紫外線硬化樹脂に紫外線を照射して 硬化させる紫外線供給手段とを備えており、また、本発 明光ディスクにおける光透過層の形成方法は、基板を回 転させながらその信号面の中心付近に液状の紫外線硬化 樹脂を滴下して環状に供給する工程と、信号面の中心付 近に環状に紫外線硬化樹脂が供給された基板を回転させ て、該回転による遠心力によって紫外線硬化樹脂を中心 側から外周側まで全体に拡散させる工程と、中心側から 外周側まで全体に拡散された紫外線硬化樹脂に紫外線を 照射して紫外線硬化樹脂を所定の厚さに硬化させる工程 とを有するものである。

【0024】従って、本発明によれば、基板を回転させ て、その遠心力によって中心付近に環状に供給された液 状紫外線硬化樹脂を信号面全体を覆うように拡散させ、 これに紫外線を照射して所定の厚さに硬化させるので、 回転させながら UV ノズル 13 から紫外線スポット光 1 50 信号面を覆う光透過層を精度良く、即ち、表面の凹凸が

無く、かつ、膜厚が均一になるように、しかも短時間で 形成することが出来る。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】光ディスクの構造を各部の厚みを強調して示す 概略断面図である。

- 【図2】信号読取の方法の一を示す図である。
- 【図3】別の信号読取の方法を示す図である。
- 【図4】光透過層形成装置の概略を示す縦断側面図である。

【図5】図6乃至図8と共に本発明にかかる光ディスク 10 における光透過層の形成方法を示す概略図であり、本図は基板載置台に基板を載置した状態を示すものである。

【図6】紫外線硬化樹脂を基板上に環状に供給する工程を示すものである。

【図7】紫外線硬化樹脂を信号面全体に拡散させる工程 を示すものである。 \*【図8】信号面全体に拡散された紫外線硬化樹脂に紫外線スポット光を照射する工程を示すものである。

【符号の説明】

- 1 光ディスク
- 2 基板
- 4 信号面
- 6 光透過層
- 7 光透過層形成装置
- 9 モータ (基板回転手段)
- 9 a 出力軸 (基板回転手段)
- 10 基板載置台(基板回転手段)
- 12 紫外線硬化樹脂供給機(紫外線硬化樹脂供給手

段)

- 14 UV照射機 (紫外線供給手段)
- 16 液状紫外線硬化樹脂

